# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-218446

(43)Date of publication of application: 31.07.2003

(51)Int.CI.

5/022 H01S GO2B 6/42 5/024 H01S H01S 5/068

(21)Application number: 2002-325657

(22)Date of filing:

08.11.2002

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(72)Inventor: MIKI ATSUSHI

YABE HIROYUKI TANIDA KAZUHIRO WATANABE YOKO SHINKAI JIRO

TAKAGI TOSHIO SASAKI GORO

(30)Priority

Priority number: 2001350674

Priority date: 15.11.2001

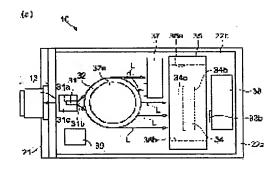
Priority country: JP

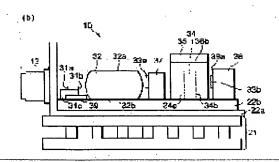
## (54) OPTICAL MODULE AND OPTICAL COMPONENT.

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical module which enables the suppression of a shift in lock wavelength due to a change in temperature of an optical element.

SOLUTION: A main part 10 of the optical module comprises a thermoelectron cooling device 21 and a chip carrier 22b installed on the thermoelectron cooling device 21 via a carrier 22a. On the chip carrier 22b, a semiconductor light emitting element 31, a lens 32, optical detectors 33a and 33b, and an etalon 34 are either directly or indirectly mounted. On the chip carrier 22b, support members 36a and 36b are secured. A plate-like member 35 is supported by the support members 36a and 36b, and is disposed above the etalon 34. Due to the structure, the plate-like member 35, the support members 36a and 36b, and the chip carrier 22b are kept at nearly the same temperature as that of the thermoelectron cooling device 21. As a result, the etalon 34 is kept at a constant temperature and thereby a change in lock wavelength can be suppressed.





### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.04.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国的扩广(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出歷公園每号 特第2003-218446 (P2003-218446A)

# (43)公提日 平成15年7月31日(2003,7.31)

10 1 S			Fl	5-42-(多考)
日 0 1 S 5/022 G 0 2 B 6/42 H 0 1 S 5/024 5/068 第本語文 示解文 除水理の数28 OL (全 2 ] (21)田園番号 特数2002 - 325657(P2002 - 325657) (22)田園田 平成14年11月8日(2002 11.8) (22)田園田 平成14年11月8日(2002 11.8) (23)福売権主題番号 特額2001 - 350674(P2001 - 350674) (32)福売日 平成13年11月15日(2001 11.15) (32)福売日 平成13年11月15日(2001 11.15) (33)福売権主要日 日本 (J P) (72)発明者 矢部 弘之 特後川県積兵市県区田谷町1番畑 住力 気工業株式会社積兵製作所内 (74)代型人 100088165	(51) lighCL <sup>1</sup>	散到配牙		D/REAC
日 1 S 5/024 日 1 S 5/024 5/068 第五数末 未確求 除求班の数28 OL (全 2 ] (21)田園29				
5/068  5	GC2B 6/42			·
(21) 田國母号 特型2002 - 325657(P2002 - 325657) (71) 田國人 000002130 住女便気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜町丁目 5 器32号 大阪府大阪市中央区北浜町丁目 5 器32号 (72) 発明者 三木 养 神奈川課権共市采区田谷町 1 番組 住友 (32) 磁先日 平成13年11月15日 (2001. 11. 16) (72) 発明者 天塚 弘之 特奈川課権共市采区田谷町 1 番組 住友 (72) 発明者 天塚 弘之 特奈川課権共市采区田谷町 1 番組 住友 文工業株式会社機長製作所内	110 2 -	•		5/068
(22) 出限日 平成14年11月8日(2002_11.8) (72) 発明者 三木 神			審定發求	未成次 景水斑の数28 OL (全 22 頁)
(72) 発明者 三木 养 (31) 優先権主題語号 特別2001 - 350674 (P 2001 - 350674)	(21) 出 <b>概</b> 20月	传题2002 - 325657(P2002-325657)	(71) 由華人	<b>产大量包工资株式会社</b>
(31) 優先権主題番号 特別2011 - 305/4 (72011	(22) 出國日	平成14年11月8日(2002-11.8)	(72) 発現者	三木 孝
(72) 英明名 关键 全型 (72) 英明名 关键 全型 (72) 英明名 关键 (72) 英明名 (72) 英丽名 (72)		\$5872001 -350674 (P2001 -350674)		<b>5.工来株式会社委员</b> 製作所内
74) 代理人 100088155	(38) 磁先程主要时		(72) 克勒者	种疾川県接雲市朱区田谷町1番即 住女
<b>并建士 县</b> 谷川 贾蓉(外4名)			(74)代型人	100088155 井壁上 長谷川 芳樹 (外4名)

## 最終区に置く

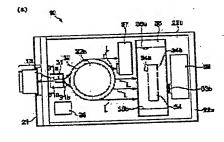
# (54) 【発明の名称】 光モジュールおよび光学協品

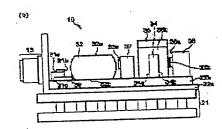
## (57) [要約]

【課題】 光学素子の温度変化によるロック法長シフト を抑制できる光モジュールを提供する。

【解決手段】 光モジュール主要部10は、熱電子冷却 器 21 と、熱電子冷却器 21 の上にキャリア22 を介 して設けられたチップキャリア22 bを有する。チップ キャリア22 b上には、半海体発光素子31、レンス3 2、光線出器33 e、33 b、及びエタロン34が直接 的又は間接的に搭載される。また。チップキャリア2.2 6上二支持部材36点、35日が固定される。板状部材 35は、支持部材 36 s. 36 bにより支持され、エタ ロン34 の上方に位置する。このような特成により、 帳 状部材35、支持部材36g、35b、及びチップキャ リア226は熱電子冷却器21ほぼ等しい温度に維持さ

れる。そのため、エタロン34の温度もまた一定化さ れ、ロック法長の変勢が抑制される。





(特許請求の範囲)

【請求項1】 光を放射する半導体発光素子と、

光入射面および光出射面を有し、前記半導体発光素子からの光を前記光入射面で受光するように配置され、逆長依存性の光透過率を有する光学素子と、

前記光学電子を透過した光を受光するように配置された 光線出器と、

前記光学素子の下方に配置され、前記光学素子の加熱および冷却の少なくとも一方を行うことの可能な温度調節 器と、

前記光学業子の上方に配置され、前記温度調節器に独的 に結合された屋根部材とを備える光モジュール。

[請求項2] 前記半導体発光票子は、シングルモード半導体レーザ素子であり、前記光学素子の返過特性は、 波長と透過率が一定に対応する領域を含んでいる、請求 項1記載の光モジュール。

【請求項 3】 前記半海体発光素子は、マルチモード半 海体レーザ素子であり、前記光学素子は、前記レーザ素 子の発掘波長域に応じて変化するパワーを有する透過光 を生成する、請求項 1記載の光モジュール。

【語求項4】 前記光学素子は、前記レーザ素子の複数のモードを含みうる透過波長域を有している。請求項8 記載の光モジュール。

【請求項5】 光を放射する半塩体発光素子と、

光入封面を有し、前記半導体発光素子からの光を前記光 入射面で受光するように配置され、波長依存性の光反射 全を有する光学素子と、

前記光学素子によって反射された光を受光するように配置された光検出器と、

前記光学素子の下方に配置され、前記光学素子の加熱および冷却の少なくとも一方を行うことの可能な進度調節器と

前記光学素子の上方に配置され、前記温度調節器に触的 に結合された屋根部材とを備える光モジュール。

【訪求項 5】 前記半座休発光素子は、シングルモード 半座体レーサ崇子であり、前記光学素子の反射特性は、 波長と反射率が一定に対応する領域を含んでいる。請求 18 5記載の光モジュール・

【請求項7】 前記半座体発光素子は、マルチモード半 築体レーザ素子であり、前記光学素子は、前記レーザ素 子の発掘波長域に応じて変化する強度を有する反射光を 生成する、請求項5記載の光モジュール。

【請求項 8】 前記光学素子は、前記レーザ素子の複数のモードを含みうる反射波長域を有している、請求項 7記載の光モジュール・

(語求項 S) 前記屋根部材は、支持部材によって支持され、前記支持部材を介して前記温度調節器と統的に結合されている。請求項 1~8のいずれかに記載の光モジュール。

【請求項10】 前記光学素子の光入封面に対向するよう

うに配置された関ロを有する第1のアパーチャ部状をさらに備え、新記第1アパーチャ部状は、前記温度調節器 済むび前記屋根部状と熱的に結合されている、請求項1 ~9のいすれがに記載の光モジュール。

[請求項11] 前記光学素子の光出射面に対向するように配置された開口を有する第2のアパーチや部材をさらに備え、前記第2アパーチや部材は、前記温度調節器および前記屋根部材と独的に結合されている。請求項1~4のいずれがに記載の光モジュール。

[請求項12] 前記光検出器がその上に固定される固定部材を更に備え、前記固定部材は、前記光検出器が前記光学条子を経由した前記半導体発光条子からの光を受光するように配置され、前記固定部材は、前記温度調節器および前記屋根部材と独的に結合されている、請求項1~11のいずれかに記載の光モジュール

(請求項13) 新記光学素子を搭載する搭載部材を更に備え、前記搭載部材は、前記温度調節器および前記屋根部材と熱的に結合されている、請求項1~12のいずれかに記載の光モジュール。

【請求項14】 前記屋根部材は、前記光学素子よりも 熱伝達率が大きい材料から接成されている、請求項1~ 1.3記載のいずれがに記載の光モジュール。

【詰ま項15】 前記支持部材は、前記光学素子よりも 熱伝経率が大きい材料から構成されている、詰求項9記 数の光モジュール。

【結束項15】 前記第1アパーチャ部材は、前記光学 素子よりも熱伝体室が大きい材料から構成されている。 請求項1 D記載の光モジュール。

【請求項1.7】 前記第2アパーチャ部財は、前記光学 素子よりも熱伝達重が大きい材料から構成されている。 請求項1.1記載の光モジュール。

【請求項18】 前記温度調節器は、ベルチェ素子である、請求項1~17のいずれかに記載の光モジュール。 【請求項1~1 前記光学業子は、エタロンまたは光学フィルタである、請求項1~18のいずれかに記載の光モジュール。

[結束項20] 光入射面および光出射面を有し、造長依存性の光速過率を有する光学素子と、

前記先入射面および前記先出射面が露出するように前記 光学素子を収容するホルタとを違える光学部品。

【請求項2·1】 光入射面を有し、波長依存性の光反射 率を有する光学素子と、

前記光入射面が露出するように対記光学素子を収容する ホルダとを備える光学部品。

[請求項22] 前記ホルダは、前記光学素子の光入所面に対向する第1の開口を有している、請求項20または21に記載の光学部品。

【詩求項23】 前記ホルダは、前記光学素子の光出財 面に対向する第2の開口を有している、請求項20代記 素の光学部品。 (請求項24) 的記水ルタは、前記光学第子よりも独 伝送率が大きい材料から構成されている、請求項20~ 23のいずれかに記載の光学部品。

【語求項25】 光を放射する半導体発光素子と、 前記半導体発光素子からの光を前記光学素子の光入射面 で受光するように配置された語求項20および22~2 4のいずれかに記載の光学部品と、

前記光学装置を透過した光を受光するように配置された 光線出器と、

前記光学部品の加熱および冷却の少なくとも一方を行うことの可能な温度調節器とを備える光モジュール。

【請求項25】 光を放射する半導体発光素子と、

前記半基体発光素子からの光を前記光学素子の光入射面で受光するように配置された語求項21、22および24のいずれかに記載の光学部品と。

前記光学装置によって反射された光を受光するように配置された光検出器と。

前記光学部品の加熱および冷却の少なくとも一方を行うことの可能な温度調節器とを備える光モジュール。 【発明の詳細な説明】

#### 100011

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システムに 使用される光モジュールに関する。

#### (0002)

【従来の技術】光モジュールは、複数の遊長成分を用いる遊長多量(WDM)伝達システムに使用される。1.55μm帯のWDMシステムにおいては、接接するブリッドの遊長間隔は、例えば、約0:8nm(1006円ェ)とされる。この遊長間隔を実現するためには、光モジュールからの光の発光波長は、グリッド遊長に対してェの、03nm以内の範囲に制御する必要がある。

【〇〇〇〇】 銀在用いられている光モジュールの多くは、半海体レーザ素子、光線出器、および温度調節器を有する。レーザ素子の光反射面から作がに放射されるレーザ光の速長を光検出器により元ニタし、モニタ結果に基づいてレーザ素子の温度が調整され、レーザ光の波長が刺剤される。造長変動を特度良く検出するため、レーザ素子と光検出器との間にエタロンが設けられる。エタロンの光透過率は、速長依存性を有している。すなわち、エタロンの光透過率は、入射光の波長に依存する。このため、光検出器によってモニタされるレーザ光の強度は、その速長に応じた値を有する。

【0004】エタロンを用いた光モジュールでは、光モジュールから放射される光の選長は以下のように制御される。図1 (e) および図1 (b) は、レーザ素子からのレーザ光の遊長と光検出器の出力電流との関係を示す様式図である。図1 (e) に示されるように、光検出器の出力電流の遊形上は、遊長入の地大に従って周期的に変化する。ここで、WDMシステムで使用されるグリット 遊長を入りとする。また、遊長入りの光が光後出器に

入射したときに光徳出籍から出力される出力電流の電流値を10とする。出力電流が電流値10となるようにレーザ素子の温度を調整することにより、レーザ光の速長がグリッド波長な0にロックされる。

【0005】光モジュールの動作中に、使用環境等の変 化に応じてエタロンの温度が変化することがある。 倒え ば、エタロンの温度が、エロからエ1人上昇すると、図 1 (b) に示されるように、出力電流の波形 F は波形 G へと長波長側にジフト してしまう。 これは、エタロンの 温度が上昇すると、エタロンが純膨張するためであり、 また、エタロンを構成する材料の屈折率が変化するため である。このような遊長シフトのため、グリッド遊長え ロにロックされるべきロック滋長は、入1ペシフトして しまう。ロック遊長シフト重石ス=み1-20は、 通常 使用される一般的な光学ガラ スからエタロンが構成され ている場合には、ロ、ロックゥェーノで程度の温度依存性 を有する。エタロンの温度変化に起因するロック波長の 変動を防ぐため、エタロンは、光モジュールのバッケー。 ジ内に設置される温度調節器によって、例えば25℃と いった温度に維持される。

## [10 0 0 53

「発明が解決しようとする課題」本発明者らは、光モジュールの波長制御性を向上させるために鋭差研究を行ったところ、以下の知見を得た。光モジュールが使用される環境によっては、光モジュールのバッケージの温度は80で程度にまで達することがある。このような場合がウェジと温度調節器との間にわららでの温度差が生じていることになる。本発明者らの研究結果によれば、光モジュール内にこのような温度差があると、独対流や無絶対が生じ、エタロンの温度を一定に推持するのが困難になることが判明した。

【10007】光速信システムにおいて逆受信される情報 量が飛躍的に増大している状況を鑑みれば、グリッド波 長間隔をいってう狭小化することが望ましい。そのよう な狭小化を図るためには、光モジュールから送出される 光の波長をより高い緒度で制御することが必要である。 したがって、エタロンのような光学素子の温度変化に伴 うロック波長の変動をいっそう抑制することが望まれる。

【0008】そこで、本発明は、光学素子の温度変化に 起回するロック波長シフトを抑制できる光モジュールの 提供を課題とする。

### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明の一側面に係る光モジュールは、光を放射する半導体発光素子、波長依存性の光透過率を有する光学素子、光学素子を透過した光を受光するように配置された光視出器、光学素子の加熱および冷却の少なくとも一方を行うことの可能な温度調節器、および温度調節器に熱的に結合された屋根部材を確えている。光学素子は、光入射面および光出射面を有

しており、半導体総先集子からの先を光入射値で覚光するように配置されている。屋根部材は、光学素子の上方に配置されている。温度調節器は、光学素子の下方に配置されている。

【ロロ1日】半端体発光素子から放射された光は、光学 幸子を返退し、光検出器に入射する。光検出器は、入射 光の強度に応じた電気信号を出力する。光学素子の迅速 室は波長依存性を有しているので、光学素子を返過した 光は、その遊長に応じた残废を有する。このため、光検 出器の出力信号は、発光会子から放射される光の変長を 示す。したがって、光検出器の出力信号をモニタすれ ば、そのモニタ結果に基づいて、発光素子から放射され る光の进長を所望のロック波長に調整することが可能に なる。屋根部状は、温度調節器と熱的に結合されている ので、温度調節器とほぼ等しい温度に維持される。した がって、屋根部材と温度調節器との間に位置する光学素 子の温度も、屋根部材および温度調節器とほぼ等しい湿 度に推持されることとなる。この結果、光学素子の熱酸 張、熱収縮および尼折字変化が抑制される。したがっ て、ロック波長の変勢が抑制される。

【0011】本発明の別の側面に係る光学部品は、光入 射面および光出射面を有し、張長依存性の光速過率を有 する光学素子と、光入射面および光出射面が露出するように光学素子を収容するホルダとを係えている。ホルダ が温度調節器と触的に結合されるようにこの光学装置を 光モジュール内に設置すると、ホルダは、温度調節器と 無ば等しい温度に推持される。したがって、ホルダに収 さされる光学素子の温度も、ホルダおよび温度調節器と ほぼ等しい温度に推持されることとなる。光学素子の追 度が一定化されるので、光モジュールのロック速長の変 動が抑制される。

【0012】 本発明のさらに別の側面に係る光モジュールは、光を放射する半葉体発光素子と、波長依存性の光度射率を有する光学素子と、光学素子によって反射された光を曳光するように配置された光検出器と、光学素子の加熱および冷却の少なくとも一方を行うことの可能な速度調節器と、温度調節器に独的に結合された屋根部はとを備えている。光学素子は、光入射面を有しており、半路体発光素子からの光を光入射面で受光するように配置されている。屋根部はは、光学素子の上方に配置されている。湿度調節器は、光学素子の下方に配置されている。湿度調節器は、光学素子の下方に配置されている。

[0013] 半導体発光素子から飲料された光は、光学素子によって反射され、光検出器に入射する。光学素子の反射率は減長体存性を有しているので、光学素子によって反射された光は、その逆長に応じた強度を有する。このたの、光検出器の出力信号は、発光素子から散射される光の波長を示す。したがって、光検出器の出力信号をモニタすれば、そのモニタ結果に基づいて、発光素子から散射される光の遊長を所属のロック波長に調整する

ことが可能になる。屋根部材は温度調め器と外的に結合されているので、屋根部材は、温度調め器とほぼ等しい 温度に維持される。したがって、屋根部材と温度調節器 との間に位置する光学素子の温度も、屋根部材および温度調節器とほぼ等しい温度に維持されることとなる。この結果、ロック速長の変動が抑制される。

[0014] 本発明のさらに別の側面に係る光学部品は、光入射面を有し、速長依存性の光反射率を有する光学素子と、光入射面が露出するように光学素子を収容するホルダとを確えている。ホルダが温度調節器と熱的に結合されるようにこの光学装置を光モジュール内に設置すると、ホルダは、温度調節器とほぼ等しい温度に維持される。したがって、ホルダに収容される光学素子の温度も、ホルダおよび温度調節器とほぼ等しい温度に維持されることとなる。光学素子の温度が一定化されるので、光モジュールのロック波長の変動が抑制される。

[0015] 屋根部材およびホルダは、光学素子よりも 独伝達率が大きい材料で構成されると好ましい。この場合、屋根部材およびホルダの温度は、温度調節器の温度 変化に対して良好な退役性を示す。この結果、ロック波 長をいっそう確実に安定化できる。

#### [00.15]

【発明の実施の形態」以下、本業明に係る光モジュールの好造な実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明においては、同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明は各触する。

【10017】 (第1の実施形態) 本発明に係る光モジュールの第1の実施形態について説明する。図2は、第1 実施形態の光モジュール1の部分切欠斡視図である。光モジュール1は、光モジュール主要部10と、ハウジング11とを備える。ハウジング11は、光モジュール主要部10を収納する本体部116、光ファイバ12を主要部10に実内する管状部115、および複数のリードピン110を備える。

[0018]以下、図3を参照しながら、主要部10について詳細に説明する。図3(e)は、主要部10を示す平面図である。図3(b)は、主要部10を示す側面図である。主要部10は、温度調節器としての熱電子冷却器21と、熱電子冷却器21の上に設けられたし字状のキャリア22eと、キャリア22eの上に設けられたチップキャリア22eと、キャリア22eの上に設けられたチップキャリア22eとで表する。

(〇〇・19] 熱電子冷却器21は、レキャリア226を介して冷却器21上に設置されるチップキャリア226 の温度を調整する。レキャリア226 およびチップキャリア226は、冷却器218 独的に結合されている。チップキャリア226 上には、半等体発光素子31、レンズ32、光検出器336、336、およびエタロン34が直接の又は間接的に搭載される。レキャリア226 およびチップキャリア226 は、シリコン(81)、一定のよこウム(A1 N)、アルミナ(A1 203)、お

よびコパール等の熱良達体から構成されていると好ましい。チップキャリア22bがSiから構成される場合、このチップキャリア22bは特にSiベンチと呼ばれる。チップキャリア22bの温度は、サーミスタS9によりモニタされる。独電子冷却器21としては、例えば、ベルチェ効果を利用した温度制御素子、すなわちベルチェ素子を利用できる。ベルチェ素子を用いれば、発光素子31およびエタロン34の温度を容易かつ確実に調整できる。

【0020】図3(b)に示されるように、発光素子3 1は、サブマウント31cを介してチップキャリア22 b上に固定されている。発光素子31は、光出射面31 6 および光反射面316を有する。光出射面316は、 レンスを含む光学部13によって光ファイバ18と光学 的に結合されている。そのため、光出射面31 eから放 **射される光は、光学部13を違って光ファイバ12人等** 入される。一方、先反射面31 bは、レンス32と光学 的に結合されている。発光集子で1の光反射面で1.6か ら端出する光は、レンズ32に入射する。発光素子31 としては、例えば分布帰鑑型(DFB)またはファブリ ペロー型の半導体レーザ素子を用いることができる。以 下の説明では、発光素子で1は、シングルモードの半導 体レーザ素子とする。このレーザ素子は、極めて狭い波 長坂のレーザ光を飲射する。したがって、このレーザ光 は、実質的に単一の遊長を有するとみなすことができ

10021] レンズ32は、図3(b)に示す適り、互いにはは平行な上面32eおよび下面32bを有する。レンズ32は、その下面32bがチップキャリア22bと接するように、樹脂接差到等によりチップキャリア22bに固定される。レンズ32は、発光素子31の光反射面31bと光学的に結合されている。先反射面31bから漏出する光は、図3(e)に示すように発散光である。この発散光は、レンズ32を透過して平行光したる。光検出器33sは、レンズ32を透過した平行光したを受光できるように配置される。光検出器33sは、チップキャリア22b上に立設された固定部材37上に設置される。光検出器33sは、受光した平行光しの強度にあれた信号を出力する。

【0022】エタロン34は、レンズ32を介して、発光素子31の光反射面315と光学的に結合されている。この実施形態では、エタロン34は、平行平板形状をしている。エタロン34は、その光入射面34sおよび光出射面345上に多層反射限を有していてもよい。この多層反射限により光入射面345および光出射面345の反射率が調整される。

【0023】図3(b)に示されるように、エタロン3 4 はチップキャリア2 2 b上に固定されている。エタロ ン3 4 の上方には、屋根部材3 5 が配置されている。チップキャリア2 2 bの下方には、冷却器 2 1 が配置され ていら、もたがって、エタロンミ4は、冷却器81と展 根部は35との間に挟まれている。以下では、図4を影 照しながら、屋根部材も5について説明する。

[00.24] 図4は、エタロン84および屋根部は3.5 の配置を示す概略斜視圏である。屋根部は25は、振鉄 の部材である。屋根部村35は、方形の平面形状を有し ている。屋根部村35は、チップキャリア226上に固 定された支持部状のちゃおよび366により支持され、 エタロン34の上方に配置されている。エタロン34の 上面と屋根部は35との間には、間隔がある。支持部は ⊙ 5 e および 5 5 bは、 ヒキャリア 2 2 e およびチップ キャリア22 6を介して熱電子冷却器21と熱的に結合 されている。屋根部材で5と支持部材でもも、35bと は、接毛列により接合されていてもよいし、溶接により 総合されていてもよい。接差対を用いる場合は、熱伝導 室の高い接差対が好ましい。このほかに、屋根部材で5 と支持部材でもも、360とは、一体に構成されていて もよい。この場合、屋根部材35と支持部材356。3 6 6との間の熱伝導性が、よりいっそう向上する。

【0025】屋根部材35は、支持部材35点、35点、チップキャリア226およびレキャリア228を介して、熱電子冷却器21と独的に結合されている。そのため、チップキャリア226、深却器21により等しい温度に維持される。エタロン34は、等しい温度に維持される屋根部材35、支持部材35点、35点、および東フキャリア226により囲まれているため、その温度を表た等しい温度に推持されることになる。このように、屋根部材35は、支持部材35点、356とともに、エタロン34の温度を調整する機能を有している。

【0025】屋根部材35および支持部材366。35 bは、銅タングステン(CuW)やコバールといった熱良 基体から構成されるごとが好ましい。本発明者6の知見によれば、エタロン34が例えば一般的な光学ガラスから構成されている場合、その熱伝達室は1、05W/m K程度である。これに対して、CuWの熱伝達室は20:DW/m Kである。このような熱伝達室の高い材料から屋根部材35および支持部材366。36bを作製すれば、ハウジング11の温度が変化した場合でも、屋根部材35および支持部材366。36bの温度を経時時間に調整できる。そのため、ハウジング11内の温度変化がエタロン34に及ぶことが確実に防止される。

【10027】光線出器30bは、チップキャリア22b上に設けられた固定部材38の第1の面38e上に固定される。第1の面38eは、エタロン34の光出射面34bに対面している。そのため、光线出器33bは、エタロン34の光出射面34bから放射される光を受光できる。本実施形態では、光検出器33bとエタロン34との把対的な位置関係は、所定の進度のエタロン34を

法協した所定のブリッド返長入口の光が光線出器33 b により所定の電流値で採出されるように決定される。光 検出器33 bの出力をこの電流値にロックすることにより、発光素子31から放射されるレーザ光の遊長がグリッド遊長入口にロックされる。具体的には、光検出器30bの出力信号に応じて熱電子冷却器21の温度を調整することにより、チップキャリア22bを介して発光素子31の温度が調整され、レーザ光の波長が一定化される。

【0028】光検出器303、335は、例えば、1 n P基板上に形成された I n G s A s 半遅休層を受光率と して有する I n G s A s = p i n型フォトダイオードで あってもよい。

【0029】光モジュール1では、エタロン34は、追 展制御された屋根部材35、支持部材35e。35b、 およびチップキャリア22bに囲まれている。そのた め、エタロン34の温度もまたこれらとはば等しい温度 となる。さらに、ハウジンダ11の内部に大きな温度を が生した場合であっても、その影響がエタロン34に及 ぶことが防止される。その結果、エタロン34の温度変 化が抑制される。よって、エタロン34の温度変化に うちいい。 も成職および屋折率変化が抑制されるので、 ロック競長の変動が抑止される。

【0030】太仁、エタロン34の温度変化の防止効果 を確認するため、本発明者らが行ったシミュレーション について説明する。図5 (a) は、シミュレーションで 用いたモデルを示す平面図である。図5(b)は、図5 (e) のモデルの1-1執に沿った概略断面図である。 また、図5 (c) は、図5 (e) のモデルの1-1時に 治った断面を含む機時斜視回である。国示の通り、この モデルは、チップキャリア22 6、エタロン、屋根部材 35、支持部は366、356、およびバウジング11 を描する。チップキャリアと25はSiから接続される ものとし、エタロンは一般的な光学ガラスから構成され るものとした。屋根部付35および支持部付35s, 3 5 bの揺成材料としては、Cu Wおよびコパールの2運 りについてシミュレーションを行った。これらの部材の 寸法は、図5 (e) および図5 (b) に示す値とした。 ジミュレーションのパラメータとして使用した各様料の 独伝達率は、以下の通りである。

【0031】Si:168.0(W/mK) 光学ガラス:1.050(W/mK) CuW:200.0(W/mK) コパール:16.0(W/mK) コパール:16.0(W/mK) このジミュレーションでは、ハウジング11内は室乗ガスが1気圧の圧力で満たされていることとした。室乗の 株伝探室は0.0250W/mKとし、粘性定数は1. フタ×10-5Pe・sとした。チップキャリア225 の温度を25でとし、ハウジング11の温度を50でとした。なお、図5(s)および図5(b)中の数値は、 シミュレーションのパラメータとして用いた便宜的な数値であり、本実施形態の光モジュール 1 の第寸法がこれらの値に限定されるものではない。

【00.32】図5および図7は、本実施形態の光モジュールにおけるエタロン周辺の温度分布をジミュレージョンにより求めた結果を示す側面図である。図5は、屋根部は35および支持部は35ま、35トがついる場合の結果を示し、図7は、屋根部は35および支持部は35年、35トがコバールの場合の結果を示す。これらの図では、支持部は35年、35トは2000年によります。

【0003】図5に示されるように、屋根部付35および支持部付35を、36bをCuWで構成した場合、エタロン34内には僅かり、2で以下の温度差があるにすきない。また、図7に示されるように、屋根部付35および支持部付36を、35bをコパールで構成した場合も、エタロン34内の温度差は0、2で程度である。したがって、いずれの場合も、エタロン34を透過して光検出器33bに入封する光の波長を結度良く一定化させることができる。

[0034] 比較のため、屋根部材35および支持部材 350, 35bがない点を除き図5 (e) ~図5 (c) と同一のモデルを用いてシミュレーションを行った。そ の結果を図らに示す。図らに示されるように、エタロン 3.4内には1、20程度の温度勾配が生じている。この 理由としては、エタロン34を構成する一般的な光学が ラスの熱伝導字が 1、 0 6W/m K程度と低いことが挙 げられる。エタロン3.4内に温度勾配があると、ハウジ ング1 1内の温度が僅かに変化しただけでも、エタロン のレーザ光速過部において温度変化が生じることとな る。しかも、エタロン3.4の熱伝導室が低いため、エタ ロン3.4 の温度変化を応答性良く抑えることはできな い、したがって、屋根部材でもおよび支持部材でもら、 365かない場合には、エタロン34の迷過率の遊長依 存性がエタロン3 4の温度変化に応じて変動することを 確実に防止することは難しい。

(0005) 本発明者6の知見によれば、一般的な光学ガラスから構成されるエタロンの温度が1で変化すると、ロック議長が約0.013nm変動する。本実施形態による光モジュール1によれば、ハウジング11(60で)とチップキャリアを26(25で)との間に35で程度の温度差が生じても、エタロンの温度分布を0.2で程度まで抑制でき、これによりロック選長の変動を0.003nm以下に抑えることができる。すなわち、ハウジングの温度変化が必要ける影響の少ない、高精度の議長制御が可能となる。

【0036】以下では、本発明に係る光モジュールの他の実施形態について説明する。第2~4の実施形態の光モジュールは、エタロン34の思辺の構成が異なる以外は、第1の実施形態の光モジュール1と等しい構成を有する。よって、第2~4の実施形態においては、第1の

実施形態との相違点を中心に説明する。

【0037】 (第2実底形態) 図9は、第2実底形態の 光モジュールにおけるエタロン、屋根部材および支持部 材の配置を示す機能斜視図である。図示の通り、屋根部 材35は、チップキャリア226上に設けられた単一の 支持部材366のみにより支持される。エクロン34 は、チップキャリア226上に対面し、エクロン34 は、チップキャリア226上に対面し、エクロン34の 一つの側面は支持部材35に対面する。屋根部材35 って納金のため、エタロン34の温度である。 は、1000元のため、エタロン34の温度で化が抑制され、ロック波長の変動が防止される。このように、屋根部材35が1つの支持部材366のみによって支持され、ロック波長の変動が防止される。このように、屋根部材35が1つの支持部材366のみによって支持される。

【0038】(第3実施形態)図10(a)は、第3実施形態の光モジュールにおけるエタロンの周辺部を示す概能斜視図である。図10(b)は、アパーチャ部材を示す斜視図である。図10(b)に示す退り、屋根部材35は、チップキャリア226上に設けられた支持部材35は、チップキャリア226上に設けられた支持部材36。

【0039】エタロン34の光入射面側には、アパーデ ヤ部材40が設置されている。アパーチャ部材40は、 屋根部は35、支持部は35a,35ヵおよびチップキ ャリア22トによって形成される開口の端部に嵌め込ま れている。関ロアパーチャ部材 4 Dは、エタロン3 4 Q 光入射面から難陥している。 アパーチャ部材40は、図 10(b) に示す通り、関ロ40eを有している。開口 40eは、エタロン34の光入射面と対向している。発 光素子31の光反射面316から放射されレンス32を 遠迢した光上は、開口406 を通過してエタロン34の 光入射面34mに入射する。アパーデッ部材40は、チ ップキャリア226上に固定されるとともに、支持部材 36s, 36bおよび屋根部村35と接触している。ア パーチャ部村40は、 Lキャリア226およびチップキ サリア226を介して独電子冷却器21と熱的に結合さ れている。したがって、アパーチャ部財 4 0の温度は、 チップキャリア226、支持部材35%、35%、およ び屋根部村35の温度とほぼ同一となる。

【0040】エタロン34の光出射面側には、アパーチャ部材41が設置されている。アパーチャ部材41は、屋根部材356。356およびチップキャリア226によって形成される開口の端部に嵌め込まれている。アパーチャ部材41は、エタロン34の光出射面から端間している。アパーチャ部材41は、アパーチャ部材40と同一の構造を有している。アパーチャ部 材41には、エタロン34を返過した光が原過できる開口416が設けられている。開口416は、エタロン34の光出射面および光視出器335と対向している。よ

って、エタロン34の後端光は、間口413を譲過して 光線出載33日に到達できる。アパーチャ部は41は、 チップギャリア22日上に固定されるとともに、支持部 は369。35日および屋根部は35と接触している。 アパーチャ部は41は、レキャリア22日およびチップ キャリア22日を介して無電子冷却器21と熱的に結合 されている。したがって、アパーチャ部は41の温度 は、チップキャリア22日、支持部は36日。36日、 および屋根部は35の温度とほぼ同一となる。

【10041】アバーチャ部材410、41は、ColW、コバールといった独良基体から構成されると好ましい。これらの材料は、上述の通り、一般的な光学ガラスから構成されるエタロンよりも高い独伝基準を有する。

【10042】第3実施形態では、エタロン34は、屋根部材35、支持部材36a、36b、アパーチャ部材40、41およびチップキャリア22bによって囲まれている。これらの構成要素は、熱電子冷却器21によってほぼ等しい温度に維持される。そのため、ハウジング11の内部に大きな温度差が生じた場合であっても、その結果、エタロン34の温度変化が抑制され、エタロン34の温度変化が抑制される。よって、ロック波長の変動も抑制される。アパーチャ部材40および41のために、エタロン34の設出表面接が削減される。このため、エタロン34の最悪の変動をが可り返長の変動をいっそう確実に抑えることができる。

[0043] (第4実施形態) 図11は、第4実施形態 の光モジュールにおけるエタロンの周辺部を示す機時料 従國である。 國示の通り、第4実施形態は、 屋根部は3 5が支持部材 3 5 a, 3.5 bにより支持され、アバーチ セ部材4 0が設けられている点で、第3 の実施形態と同 - である。第3の実施形態と異なる点は、アパーチャ部 材々すが用いられていないこと。そして、光検出器33 bが固定される固定部状3 Bがアパーチャ部状 4 1 の代 わりに設置されていることである。 固定部材で 8は、屋 根部付35および支持部付35s, 35bに接触する。 固定部は38は、チップキャリア226上に設けられる とともに、屋根部村35および支持部村35g。35b と接触している。固定部状38は、 Lキャリア22をお よびチップキャリア22とを介して熱電子冷却器21と 熱的に結合されている。 したがって、固定部材で8の温 度は、チップキャリア226、屋根部は35および支持 部材35g,35bとはほ同一となる。

【0044】このように、エタロン34は、ほぼ同一の 温度に制御される屋根部は35、支持部は35を、35 b、アバーチャ部は40、固定部は38およびチップキャリア225によって囲まれている。したがって、エタロン34の温度変化は確実に抑制される。よって、ロック速長の変勢も抑制される。アバーチャ部は40および 国定部付ってのために、エタロンで4の選出表面はが制 適される。このため、エタロンで4の温度変化およびロック被長の変動をいっそう確実に抑えることができる。 [0045] 続いて、第5および第5の実施形態について説明する。これらの実施形態では、上記の実施形態におけるエタロンで4、屋根部付きちおよび支持部付きちゅ、355の代わりに、エタロンを含む光学装置5日が使用されている。第5および第55実施形態は、屋根部はで、第1~第4実施形態と異なる。これらの点を除くと、第5および第5実施形態は、第1実施形態の光モジュール1と同様の構成を有する。以下では、相違点を中心に説明する。

[0045] (第5実施形態) 図12は、第5実施形態 の光モジュールでの部分切欠斜視図である。図12に示 されるように、光モジュール2は、光学装置50を有す る。図18は、光学装置50を示す概略斜視図である。 光学装置 50は、エタロン51 およびフレーム部は5.2 ~54を有する。エタロン51は、平行平板形状をして いる。先検出器335と工物ロン5寸との相対的な位置 関係は、所定の温度のエタロン51を返退した所定のグ リット波長 A O の光が光検出器 B B B により所定の電流 値で検出されるように決定される。フレーム部状52~ 5.4は、エタロン5.1の光入射面5.1e および光出射面 5 1 6 を除く 3 つのぼり合う側面上に取り付けられてい る。エタロン51の上方に位置する。フレーム部材53 は、第1~第4実施形態における屋根部材で5に相当す る。フレーム部材52~54は、光入射面516および 光出封面5.1 6が露出するようにエタロン5.1 を保持す るホルダとして機能する。フレーム部状ち2~5.4は、 熱伝送率の高い材料、例えば、 OUW やコパールから様 成されている。 フレーム部材52~54は、エタロン5 1 よりも高い熱伝導率を有している。

【0047】図13に示されるように、光学装置50は、フレーム部材52~54が取り付けられていないエタロン51の底面がチップキャリア226と接触する方にチップキャリア226と上に固定される。フレーム部材52~54は、上キャリア226を介して無電子冷却器21と無約にいるため、フレーム部材52~54はいずれもチップキャリア26をなる。したがって、等いい温度をつち4はいずれもチップキャリア22とおよびフレーム部材52~54はいずれもチップキャリア22とおよびフレーム部材52~54はいずれるエタロン51の無ちょってその4つの側面を囲まれるエタロン51の無いで、まりに温度に推持される。その結果、エタロン51の無いの、無収箱および尼折室変化が防止され、ロック派長の変動が抑制される。

【0048】チップキャリア286と接触する光学装置 50の底面にはフレーム部はが取り付けられていないた の、光学装置50をチップキャリア226上に固定する 際、ロV硬化樹脂を用いることができる。具体的には まず、この接触面にロV硬化樹脂を塗布する。次に、ロ V硬化樹脂が塗布された接触面をチップキャリア226 に当てて光学装置50をチップキャリア226上に載置 するとともに、光軸調整を行う。その後、エタロン51 を選して栄外域光を照射しロV硬化樹脂を硬化させる。 これにより、光学装置50がチップキャリア226上に 国定される。このような手順により、光学装置50の取 り付け作業が容易になる。

【00.49】(第5実施形態)第5実施形態の光モジュールは、使用される光学装置が異なる点を焼き、第5実施形態の光モジュールと同一の構成を有する。以下では、相違点を中心に説明する。

[0050] 図14(e) は、第6実施形態にて採用される光学装置60を示す機能斜視図である。図14

(b) は、光学装置600株成を示す分解料提図である。光学装置60は、エタロン51と、フレーム部材52~55と、カバー部材55および57とを有する。マレーム部材52~55およびカバー部材55、57は、独伝達率の高い材料、例えば、Cuwやコバールから構成されている。これらの部材は、エタロン51よりも高い熱伝学率を有している。これらの部材は、エキャリア226およびデップキャリア226を介して熱電子冷却器21と熱的に結合されている。

100.517 フレーム部材52~55は、エタロン51 の光入射面5~6 および光出射面5~6 を除く4つの側 面に取り付けられている。エタロン51の上方に位置す る。フレーム部は53は、第1~第4実施形態における 屋根部は35に相当する。カバー部は55は、エタロン 5 1の光入射面と接するように取り付けられ、カバー部 材 5 7 はエタロン 5 1 の光出射面と接するように取り符 けられる。カバー部付55,57は、それぞれ開口55 e、578を有する。関ロ558は、エタロン51の光 入射面と対向している。開口576は、エタロン51の 光出射面を対向している。フレーム部材52~55なら びにカバー部材56および5.7は、エタロン51の光入 射面および先出射が露出するようにエタロン5 1を保持 するホルダとして概能する。発光素子31からの光は、 レンズ32を道通した後、開口部5.5 6 からエタロン5 1の光入封面に入封し、エタロン5.1を逃退し、エタロ ン51の光出射面から開口部57 sを通って光検出器3 Зыに到達することができる。

【0052】光学装置50は、フレーム部材55がチップキャリア22 bと接するように、チップキャリア22 b上に固定されている。そのため、フレーム部材52~55およびカバー部材55。57は、チップキャリア2 2 bと振ば等しい温度に維持される。エタロン51は、カバー部材55。57の間口552。56bから露出する部分を除けば、全表面をフレーム部材52~55およ

びカバー部付うで、57によって覆われている。このため、エタロン51は、フレーム部材52~55およびカバー部材56、57とほぼ等しい温度に指導される。よって、ロック流長の変勢が抑制される。

(0053) エタロン51は、フレーム部材52~55 およびカバー部材56,57によって変われるので、そのサイスを小さくできる。そのため、エタロンの材料コストを低減できる。また、あらかじめ光学延置50を用意しておけば、光モジュールを作製する際に光学装置50をラップキャリア225上に転置し、光軸調整を行ってから光学装置50を固定するだけで、光学建置50の設置が完了する。よって、光モジュールの製造工程が筋管になる。

【0054】光学経費50では、エタロン51がフレーム部材52~55およびカバー部材55。57によって変われている。しかし、カバー部材55。57については、いずれか一方だけを設けてもよい。また、フレーム部材52~55を一体に構成し、エタロン51がこの一体型のフレーム部材に囲まれていてもよい。さらに、カバー部材55。57は、一体型のフレーム部材に固定されていてもよい。

【0055】 (第7実施形態)第7実施形態の光モジュールは、使用される光学装置が異なる点を除き、第5実施形態の光モジュールと同一の結成を有する。以下では、相違点を中心に説明する。

(0056) 図15 (e) は、本実施形態で復用される 光学経電70を示す斜視図であり、図15 (b) は、光 学統電70の分解斜視図である。光学装置70は、エタロン51と、保持部材58および59を有している。保持部材58、59は、Lキャリア22をおよびチップキャリア226を介して熱電子冷却器21と熱的に結合されている。保持部材58および59は、エタロン51の光入射面および光出射面が露出するようにエタロン51を保持するホルダとして機能する。保持部材58、59は、熱伝磁率の高い材料、例えば、CUWやコバールから構成されている。これらの部材は、エタロン51よりも高い熱伝導率を有している。

【0057】保持部は58は、エタロン51が収容される凹部586を有する。凹部586の底面586には、開口58cが設けられている。保持部は59も、保持部は58と同様に、開口59cと、エタロン51が収容される凹部(図示せず)とを有する。開口58cは、エタロン51の光入対面および光出対面の一方と対向し、開口59cは、他方と対向する。発光素子31からの光は、これらの開口を介してエタロン51が出対する。【0058】光学楽者70を使用した場合でも、エタロン51の温度は、保持部は58,59を介して対理制される。よって、ロック派長の変動が抑制される。また、エタロン51は、保持部は58,59によって覆われるの

で、そのサイズを小さくできる。そのため、エタロンの 材料コストを低減できる。さらに、あらかじの光学装置 7 Oを用意しておけば、光モジュールを作製する際に光 学装置すりをチップキャリア28日上に試置し、光轴調 空を行ってから光学装置 7 Oを固定するだけで、光学装置 7 Oの設置が完了する。よって、光モジュールの製造 工程が簡易になる。

【0059】(第8実施形態)次に、第8の実施形態について説明する。第1~第7実施形態では、互いに平行な光入射面と光出射面を有する平行平板形状のエタロンが使用されている。しかし、この代わりに、光入射面と光出射面が相対的に傾斜したウェッジエタロンを使用してもよい。第8実施形態の光モジュールは、第1実施形態における平行平板エタロンをウェッジエタロンで置き換えた構成を有している。この点を除くと、第8実施形態は、第1実施形態の光モジュール1と同一の構成を有する。以下では、相違点を中心に説明する。

[100150] 図15(e)は、この実施形態の光モジュールの主要部10を示す平面図であり、図15(b)は、その主要部10の側面図である。図17は、ウェッジエタロン34の周辺部を示す概略製視図である。ウェッジエタロン34において、光入射面346治よび光出射面346は、微小な角度を表現して相対的に傾斜している。ここで角度のは、エタロン34に入射した光が光入射面346と光出射面346との間でき至于浄を起こし得る範囲に決められる。具体的には、角度のは、01・以上の、1・以下であると好通である。光入射面346治よび光出射面346上には、多層反射限が設けられていてもよい。この多層反射限により光入射面346治なび光出射面346的反射率が調整される。

[10051] ウェッジエタロン34を使用した場合でも、第1実施形態と同様に、屋根部は35および支持部は36s、35bによってエタロン34の温度変化が抑制される。したがって、ロック进長の変勢が抑制される。

【10052】ウェッジエタロン34の光入射面34eおよび光出射面34bが互いに傾斜しているため、これらの面34e。34bの間環は傾斜方向に沿って変化している。そのため、ウェッジエタロン34の透過速長も、傾斜方向に沿って変化することとなる。この性質は、ウェッジエタロン34をチップ・ウェッジエタロと上に実践するときに有益である。つまり、ウェッジエタロととができる。平行平振エタロンを配合しなければ、所定のロックに表がある。これに対し、ウェッジエタロンは、その向きを調整する必要がある。これに対し、ウェッジエタロンは、その向きを調整すれば、所述のロック派長を

けることができる。このように、ウェッジエタロンは、 実装時に回転による位置調整を必要としないので、実装 が容息である。

【0068】第2~第7実施形態の平行平板エタロンの代わりに、ウェッジエタロンを使用してもよい。平行平板エタロンとウェッジエタロンとの間に温度変化上の違いはほとんどないので、ウェッジエタロンを使用しても、ロック遊長の変化を抑制できる。

10054] 上記実施形態におけるエタロンは、発光素子の1から放射される光の遊長に応じた強度を有する光を生成するために使用されている。このようなエタロンの作用は、遊長依存性の透過率を有する他の光学素子によっても得ることができる。この光学素子も、エタロンを同様に、その湿度変化によって透過特性が変化しる。したがって、本発明は、エタロンの代わりにこのような光学素子を備える光モジュールにも適用できる。このような光学素子の一例として、光学フィルタを挙げるとができる。以下では、エタロンに代えて光学フィルタを使用する実施形態について説明する。

【0065】(第9実施形態)この実施形態では、図2 一図4に示される光モジュール1のエタロン34の代わりに光学フィルタが設置されている。この点を除くと、第9実施形態は、第1実施形態の光モジュール1と同一の構成を有する。以下では、相違点を中心に説明する。 【0055】光学フィルタは、短波長透過フィルタ、長来長返過フィルタ、およびパンドパスフィルタのいずれであってもよい。光学フィルタは、上キャリア223

液長達通フィルタ、およびハフドバスフィルスのいまいであってもよい。光学フィルタは、 Lキャリア228 およびチップキャリア228を介して熱電子冷却器21と 独的に結合している。光検出器33 b と光学フィルタとの相対的な位置関係は、 所定の温度の光学フィルタを透適した所定のグリッド波長10の光が光検出器33 b により所定の電流値で検出されるように決定される。

[0067]図18(s)~図18(c)は、この実施 形態の光モジュールに関して、発光素子31の出力光の 遊長と光検出器336の出力電流との関係を示してい る。図18(4)は、長波長透過フィルタを使用したと きの遊長+出力電流の関係を示し、図18(b)は、接 波長透過フィルタを使用したとき、図1°8(c)は、パ シドパスフィルタを使用したときの選長 - 出力電流の関 係をそれぞれ示している。ここで、発光素子31は、シ ングルモードの半導体レーザ素子 とする。 これらの図に おいて、出力電流はフィルタの透過率に対応している。 [0058] 図18 (s) ~図18 (c) に示されるよ うに、使用されるフィルタの透過特性は、 波長と透過率 が一意に対応する領域を含んでいる。このため、この領 極に含まれる波長は、光検出器38kの出力電流と一意 に対応する。したがって、光検出器336の出力電流に **巻づいて、発光素チ31の出力レーザ光の波長を求める** ことができる。进長入りの光が光検出器335に入射す ると、光線出器33bの出力電流値が10となる。WD Mシステムで使用されるグリッド遊長がよりの場合、出力電流が上りとなるように発光素子で、の温度を調整することにより、レーザ光の遊長がグリッド遊長もりにロックされる。

[10059] 第1実施形態におけるエタロン34の代わりに光学フィルタを使用する本実施形態でも、第1実施形態と同様の利点を得ることができる。すなわち、光学フィルタは、屋根部は35、支持部は36年、36日およびチップキャリア22日に囲まれている。屋根部は35、支持部は36年、36日およびチップキャリア22日の温度は、熱電子冷却器21により制御されて、ほぼ等しい温度となる。そのため、光学フィルタの温度変化が抑えられ、それに応じてロック運長の変動が抑えられる

[0070] 同様に、第2~第7票施形態におけるエタロンの代わりに光学フィルタを使用しても、ロック波長の変動を抑制できる。

[10071] (第10実施形態) この実施形態は、主要部10における部品の配置が第9実施形態と異なる。この実施形態では、光線出器38bが、光学フィルタによって反射された光を受け取るように配置されている。この点を除くと、第10実施形態は、第9実施形態の光モジュールと同一の構成を有する。以下では、相違点を中心に説明する。

[0072] 図19 (a) は、この実施形態の光モジュ ールの主要部10を示す平面図であり、図19 (b) は、その主要部10の側面図である。図20は、光学フ イルタ54の周辺部を示す機能制視図である。光学フィ ルタ5.4は、チャプキャリア2.26上に設置されてい る。光学フィルタ54は、 Lキャリア228およびチャ プキャリア22 6を介して施電子冷却器2 1 と熱的に結 合している。 完学フィルタ6.4 は、レンズ3.2 を介して 発光素子31 に光学的に結合されている。光学フィルタ 54の入封面546は、レンズ32から出射する平行先 Lの進行方向に対して傾斜している。 光検出器33b は、光入射面64~に対面している。そのため、光検出 器33 bは、光学フィルタ5 4 の光入射面 5 4 e で反射 された光を使光できる。光学フィルタ 5 4 は、 遊長依存 性の光反射率を有している。すなわち、光学フィルタも 4 の光反射学は、入射光の速長に依存する。光検出器3 3 5 と光学フィルタ 5 4 との相対的な位置関係は、所定 の温度の光学フィルタ 6.4 によって反射 された所定のグ リッド波長もロの光が光検出器38日により所定の電流 値で検出されるように決定される。

[0073] 光学フィルタ64の上方には、屋根部付35が配置されている。屋根部付35は、チップキャリア286上に固定された支持部付366および366は、屋切支持されている。支持部付366および366は、屋根部付350階接する2辺にそれぞれ連結されている。光学フィルタ64は、レンズ32と支持部付366との

間に配慮されている。屋根部は35は、支持部は360 および350を介して熱電子冷却器21に熱的に結合されている。屋根部は35と支持部は365。360とは、接差別により接合されていてもよいし、海接により接合されていてもよい。接差別を用いる場合は、熱伝導率の高い提系到が好ましい。このほかに、屋根部は35と支持部は365。350とは、一体に構成されていてもよい。この場合、屋根部は35と支持部は355。350との間の熱伝導性が、よりいっそう向上される。

[0074] 光検出器33bは、発光業子31の出力光のうち光学フィルタ64によって反射された成分を検出する。したがって、光検出器33bの出力電流は、光学フィルタ64の反射特性の影響を受ける。つまり、光学フィルタ64の反射波長域が光検出器33bの出力電流に影響する。

【0075】光学フィルタは、程度長途過フィルタ、長速長途過フィルタ、およびパンドパスフィルタのいずれであってもよい。図21(e)~図21(c)は、この実施形態の光モジュールに関して、発光素子31の出力光の波長と光検出器336の出力電流との関係を示している。図21(e)は、長波長途過フィルタを使用したときの波長ー出力電流の関係を示し、図21(c)は、パンドパスフィルタを使用したときの波長ー出力電流の関係をでれてれ示している。ここで、発光素子31は、シングルモードの半導体レーザ素子とする。これらの図において、出力電流はフィルタの反射率に対応している。

【0075】図21(e)~図21(c)に示されるように、使用されるフィルタの反射特性は、 遊長と反射率が一意に対応する領域を含んでいる。このため、この領域に含まれる遊長は、 光検出器 33 6 0の出力電流に一般でする。 したがって、 光検出器 33 6 0の出力電流に基づいて、 発光素子31 0出力レーザ光の遊長を求めることができる。 遊長入口の光が光検出器 33 6 に入れずると、 光検出器 33 6 0出力電流値を 1 0 となる。 W D M システムで使用されるグリッド波長が入口の場合、 出力電流が 1 0 となるように発光素子31 0温度を調整することにより、 レーザ光の遊長がグリッド途長入口にロックされる。

【0077】本実施形態でも、第1実施形態と同様の利点を得ることができる。すなわち、光学フィルタ54は、屋根部材35、支持部材35b。35cおよびチップキャリア22bに囲まれている。屋根部材35、支持部材35b。35cおよびチップキャリア22bの温度は、熱電子冷却器21により制御されて、ほぼ等しい温度となる。そのため、光学フィルタの温度変化が抑えられ、それに応じてロック張長の変動が抑えられる。

[0078] 同様に、第2~第7実施形態におけるエタ。 ロンの代わりに光学フィルタを使用し、光学フィルタの 受到先を練出するように先換出襲ささもを配置しても、 ロック液長の変動を抑制できる。このように、本発明 は、光学フィルタの反射光の強度に基づいて発光無子の 出力波長をモニタする光モジュールにも適用できる。 [40079] 上述のように、第3実施形態では、エタロ ン34の光出射面に対向する開口を有するアパーチャ部 材 4 1 が使用されている。しかし、エタロン3 4 に代え て光学フィルタを使用し、光学フィルタの反射光を検出 する場合は、アパーチャ部材41の代わりに、閉口のな いカバー部材を設置してもよい。第4実施形態では、光 検出器 33 bがエタロン34の光出射面と対向するよう に固定部材3.8が配置されている。しかし、エタロン3 4 に代えて光学フィルタを使用し、光学フィルタの反射 光を検出する場合、固定部材38は、光検出器336が 光学フィルタの光入射面と対向し、光学フィルタの反射 光を覚光できるように配置される。いずれの場合も、固 定部材3.6は、エタロンまたは光学フィルタを軽由した 発光素子の1からの光を光検出器のでもが気光するよう に配置される。第5および第7実施形態では、エタロン 5 1 の光出射面に対向する開口を有するカバー部材 およ び保持部材が使用されている。 しかし、エタロン5 1に 代えて光学フィルタを使用し、光学フィルタの反射光を 検出する場合は、このような開口は必要なし、この場 合。光検出器33 bは、光学フィルタの光入射面と対向 し、光学フィルタによって反射された発光素子 3.1 から

の光を受光するように配置される。 【GO 8 0】(第11実施形態)この実施形態は、発光 素子31がマルチモード半達体レーザ素子という点で、 シングルモード半達体レーザ素子を使用する第9実施形態と異なる。この点を除くと、第11実施形態は、第9 実施形態の光モジュールと同一の様成を有する。以下では、相違点を中心に証明する。

[00.81] 発光素子の1は、マルチモードのレーザ光を放射する。したがって、この実施形態の光モジュールは、発光素子の1の複数のモードの中心进長に対応した複数のロック速長を有する。この光モジュールをWDM運信システムで使用する場合、これらのモードの中心遊長は、所定の遊長にロックされる。ここで、中心遊長とは、例えば、最小二乗法によって針算される平均遊長である。

【40082】この実施形態では、図2~図4に示される 光モジュール)のエタロン34の代わりに光学フィルタ が設置されている。光学フィルタは、海波長透過フィルタ。 長波長透過フィルタ。 台よび無域通過フィルタのい すれであってもよい。図22(≤)~図22(c)は、 それぞれ、長波長通過フィルタ。帯域通過フィルタおよ が短波長通過フィルタの光透過特性および光反射特性を 示している。図中の実践は透過波長期を示しており、破 質は反射波長期を示している。これらの透過時および反 新域の形状は、誘電体を肩膜フィルタにおいて実現する ことができる。図22(a)〜図22(c)に示されるように、これらの光学フィルタは、波長依存性の光速退率および光反射率を有している。

[0083] 光検出器30 6は光学フィルタの透過光を 受け取るので、光学フィルタの透過域が光線出舞38ヵ の出力に影響する。図23 (e) ~図23 (c) は、図 22(a)~図22(c)に示された返過域70、72 および74と、発光素子31で生成された光のマルチモ ードスペクトルフェとの関係をそれぞれ示している。図 23(a)~図23(c)に示されるように、透過47 ロ、7 2および7 4は、いずれもマルチモードスペクト ルフ6と重なりを有している。長波長遠遮フィルタおよ び短波長通過フィルタの透過増プロおよび74は、マル チモードスペクトル7 5に含まれる複数のモードのうち - つ以上を含むように決定されることが好ましい。 帝極 透過フィルタの透過塩7.2は、マルチモードスペクトル 7.6に含まれる複数のモード間の間隔よりも広い幅を有 することが好ましい。いずれにせよ、光学フィルタの途 過域は、発光素子31で生成されるマルチモー下光の視 蟄 のモードのうち二つ以上を含みうる広さを有してい

【0084】図84(a)は、所望の中心選長で発掘しているマルチモード発光素子の1のスペクトル76と光学フィルタの透過域70とを示す。図84(b)は、所望の中心選長より低し強長で発掘している発光素子の1のスペクトル78と光学フィルタの透過域70とを示す。図84(c)は、所至の中心選長より高い選長で発掘している発光素子の1のスペクトル80と光学フィルタの透過域70とを示す。この例では、光学フィルタの透過域70とを示す。この例では、光学フィルタは、長途長速過フィルタである。

【0085】図24(e)一図24(c)において、マルチモードスペクトル75、78および8のと透過速70との重なり面接は、互いに異なっている。この面接の違いは、光検出器336の出力電流に反映される。進に、重り面接が大きいほど、出力電流も大きくなる。逆に、重なり面接が小さいほど、出力電流は小さくなる。近に、重なり面接が小さいほど、出力電流は小さくなる。近に、重なり面接が小さいほど、出力電流は小さくなる。したがって、光検出器336の出力電流は小さくなる。したがって、光検出器336とにより、発光素子31の発展であることにより、発光表子31が広い発展スペクトルと光学フィルタの透過波長域との重なりの程度を測定することにより、発展波長域との変化を検出する。

【0086】本実施形態でも、第1実施形態と同様の利点を得ることができる。すなわち、光学フィルタは、ほぼ等しい温度に制御された屋根部材でき、支持部材できょ。25 日およびチップキャリア22 日に囲まれている。そのため、光学フィルタの温度変化が違えられる。これにより、光学フィルタの速速波長塚の変化が違えられる。これにより、光学フィルタの速速波長塚の変化が違えら

れるので、発光票子316党海波長板をより精度良く安 定化し、ロック波長の変動を抑えることができる。

【〇〇87】同様に、第2~第7実施形態におけるエタロンの代わりに光学フィルタを使用し、発光無子3.1としてマルチモード半導体レーザ素子を使用しても、ロック证長の変動を抑制できる。

[10086] (第12実施形態) この実施形態は、主要部10における部品の配置が第11実施形態と異なる。この実施形態では、光視出器33bが、光学フィルタによって反射された光を受け取るように配置されている。つまり、この実施形態の主要部10は、図19(e):19(b) および20に示されるような構成を有している。この点を除くと、第12実施形態は、第11実施形態での光モジュールと同一の構成を有する。以下では、第11実施形態との相違点を中心に説明する。

【〇〇89】マルチモード発光素子31からの光は、レンズ32を介して光学フィルタ54に入射する。光検出器33 bは、発光素子31の出力光のうち光学フィルタ54によって反射された成分を検出する。したがって、光検出器33 bの出力電流は、光学フィルタ54 の反射特性の影響を受ける。つまり、光学フィルタ54 の反射 波長地が光検出器33 bの出力電流に影響する。

(10090) 光学フィルタ64は、長速長遅遅フィルタ、短波長遅遅フィルタおよび帯域逼週フィルタのいずれであってもよい、光学フィルタ64の反射波長域は、図22(s) に示されている。光学フィルタ64の反射波長域は、発光素子31のマルチモードスペクトル76と重なりを有している。長波長遅遅フィルタおよび接近長週週フィルタの反射域は、マルチモードスペクトルに含まれる複数のモードのうち返りに決定されることが好ましい。帯域透過フィルタの反射域は、マルチモードスペクトルに含まれる複数のモードの間隔よりも広い偏を有することが好ましい。ではれたせよ、光学フィルタ64の反射域は、発光素子31で生成されるマルチモード光の複数のモードのうち二つ以上を含みうる広さを有している。

【100913】光线出器3.3 bの出力は、光学フィルタ54の反射域と発光素子31からのマルチモード光のスペクトルとの重なりの程度に応じて変化する。光検出器35bの出力電流に基づいて発光素子31の温度を調整することにより、発光素子31の発展波長域が所望の波長域に調整され、各モードの中心波長が所望の遊長にロックされる。

【DD 92】本実施形態でも、第11実施形態と同様の利点を得ることができる。すなわち、光学フィルタ54は、ほぼ等しい温度に制御された屋根部材65、支持部材356、366およびチップキャリア225に囲まれている。そのため、光学フィルタ64の温度変化が抑えられる。これにより、光学フィルタの反射进長極の変化が抑えられるので、発光素子31の発展波長極をより稀

成長く安定化し、ロック波長の変動を抑えることができ ス

【0093】同様に、第2~第7実施形態におけるエタロンの代わりに光学フィルタを使用し、光学フィルタの反射光を検出するように光検出器33トを配置し、発光無子31としてマルチモード半達体レーザ素子を使用しても、ロック波長の変動を抑制できる。

【0094】本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、第3の実施形態では、アバーチャ部材40、41は、屋根部材35および支持部材356、366に接触するように設置されている。しかし、アバーチャ部材40、41は、屋根部材35および支持部材356。356と離間させても、のような配置でも、アバーチャ部材40、41の温度は、チップキャリア226を介して冷却器21とはば等しい温度に調整される。このため、アバーチャ部材40、41の温度は、屋根部材35および支持部材356。356とほぼ同一となる。したがって、第3の実施形態とはぼ同様の効果が得られる。

【0095】アパーチャ部材40,41は、屋根部材35、支持部材35e,36b、およびチップキャリア22bの少なくとも一つと接触していればよい。アパーチャ部材40,41の温度は、アパーチャ部材40,41と接触する部材を介して、屋根部材35、支持部材36e,35b、およびチップキャリア22bと等しくされる。そのため、第3の実施形態と関係同様の効果が待られる。また、アパーチャ部材40,41は、エタロンや光学フィルタと接触していてもよい。

【0096】屋根部は35、支持部は366、36.6、アパーチャ部は4.0、41、および固定部は38の対法は、エタロンや光学フィルタの大きさおよびは質を考慮に入れ、第1の実施形態において説明したシミュレーション等に基づいて決定されることが摂ましい。

[0097] チップキャリア22bを用いず、発光素子31、レンズ32、エタロン(または光学フィルタ)、支持部材356,35b、および固定部材37,38を独モ子冷却器21上に直接搭載しても良い。

【0098】半座体発光素子31の出力速長極は、1. 55mm帯に限られない。また、ロックされる波長の値は、WDMに関して決められた!TUグリッドに限られない。

### [0099]

(発明の効果)以上詳細に試明したように、本発明の光 モジュールでは、温度調節器と屋根部材またはホルダと によって光学素子の温度がほぼ一定に維持されるため、

ロック波長シフトを抑制することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】図1(a)、(b)は、半等体レーザ素子から のレーザ光の波長と光検出器の出力電流との関係を示す 様式図である。 (図2)図2は、第1の実施形態の光モジュール1の一 新統新部を有する斜線図である。

【図②】図③(a)は、光モジュール主要部10を示す 平面図である、図②(b)は、光モジュール主要部10 を示す側面図である。

[図4]図4は、板状部材35とエタロン34との位置関係を示す斜視図である。

【図51 図5 (a) は、シミュレーションに用いたモデルの平面図である。図5 (b) は、図5 (s) の1-1 株に沿った断面図である。図5 (c) は、図5 (a) の1-1 株に沿った断面図である。

【図6】図6は、エタロンの温度分布を求めたシミュレーション結果の一例を示す図である。

【図7】図7は、エタロンの温度分布を求めたシミュレーション結果の他の例を示す図である。

【図8】図8は、板状部材及び支持部材のない場合について、エタロンの温度分布を求めたシミュレーションの、 括異を示す図である。

【図9】図9は、第2の実施形態の光モジュールにおいて、エタロン、板状部材、及び支持部材の位置関係を示す斜視図である。

【図10】図10(a)は、第3の実施形態による光モジュールのエタロンの周辺部を示す斜挺図である。図10(b)は、アパーチャ部材を示す斜視図である。

【図11】図11は、第4の実施形態による光モジュールのエタロンの周辺部を示す斜視図である。

[図12]図12は、第5の実施形態の光モジュールの一部破断部を有する斜視図である。

【図1/3】図1/3は、光学部品の一例を示す斜視図である。

【図14】図14(s)は、光学部品の他の例を示す斜 観図である。図14(b)は、図14(s)の光学部品 の構成を説明する模式図である。

[図15] 図15(e) は、光学部品の他の例を示す斜 提図である。図15(b) は、図15(e) の光学部品 の構成を説明する模式図である。

[図15] 図15(e) は、第8実施形態の光モジュールの主要部を示す平面図であり、図15(b) は、その主要部を示す側面図である。

【図17】図17は、第8実施形態におけるウェッジエタロンの周辺部を示す機略斜視図である。

【図18】図18(e)~(c)は、第9実施形態の光 モジュールに関して、発光素子の出力光の変長と光検出 器の出力電流との関係を示している。

【図19】図19(e)は、第10実施形態の光モジュールの主要部を示す平面図であり、図19(b)は、その主要部を示す側面図である。

【図20】図20は、第10実施形態における光学フィルタの周辺部を示す概略斜視図ある。

[図21] 図21 (e) ~ (c) は、第10実施形態の

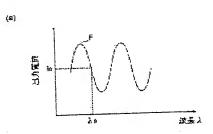
光 モジュールに関して、 発光漢子の出力光の滋養と先後 出器の出力電流との関係を示している。

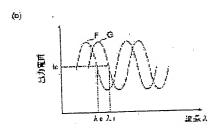
[図22] 図22(e)~(c)は、長波長通過フィルタ、帯域通過フィルタおよび短波長通過フィルタの特性を示している。

[図23] 図23 (e) ~ (c) は、図22 (e) ~ (c) に示される返過波長頃とマルチモードスペクトルとの関係を示す図である。

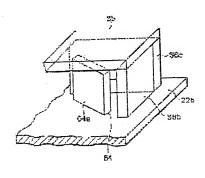
【図24】図24(e)は、所望の波長で発展している マルチモードレーザ素子のスペクトルと光学フィルタの 返週波長垣を示し、図24(b)は、所望の波長より低 い波長で発振しているマルチモードレーザ素子のスペク トルと光学フィルタの透過波長垣を示し、図24(o)

[図1]





[图20]

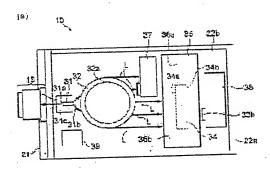


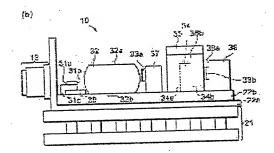
は、所望の接長より高い接長で発掘しているマルチモードレーザ素子のスペクトルと光学フィルタの法選続長期 を示している。

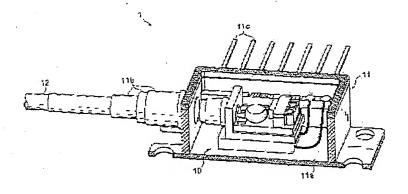
## [符号の説明]

1, 2…光モジュール、10…主要部、11…ハウジング、12…光ファイバ、21…熱電子冷却器、22…チップキャリア、31…半连体発光素子、32…レンズ、35。30。、336…光核出器、34…エタロン、35…版状部材、35。、3566…支持部材、37、38…固定部材、40、41…アパーチャ部材、50。50…光学部品、51…エタロン、52…フレーム部材、56、57…カバー部材、56、59…保持部材、54…光学フィルタ。

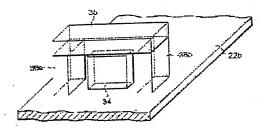
[図3]



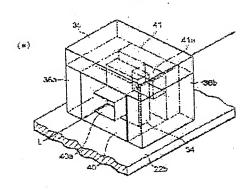








(図10)





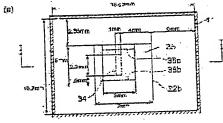
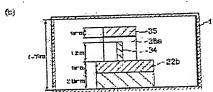
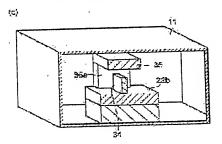
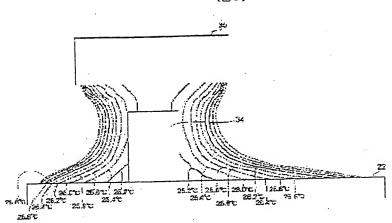


图5)

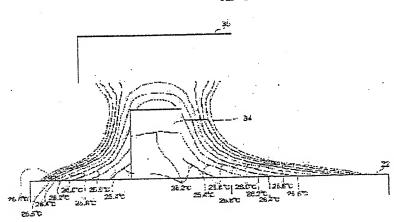




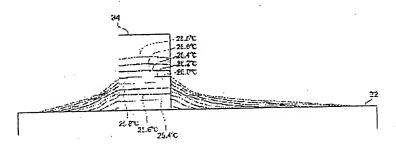


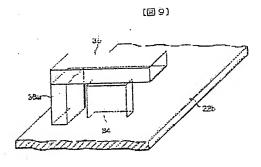


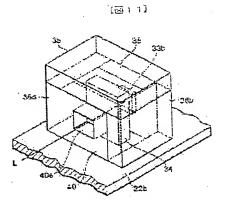
# [図7]

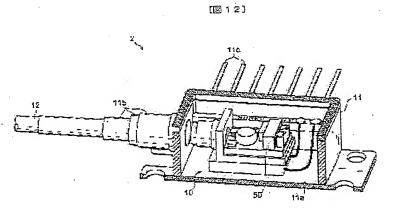


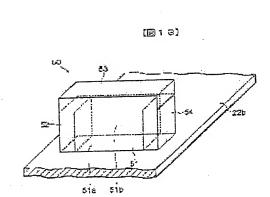
(E) 8

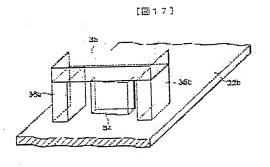


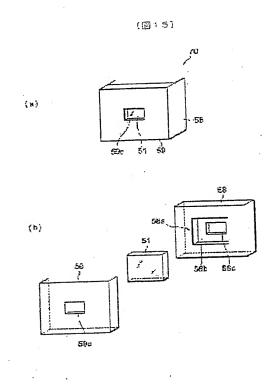


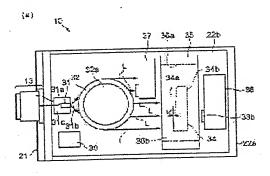


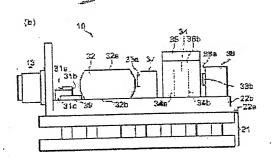


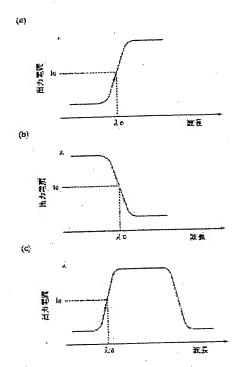




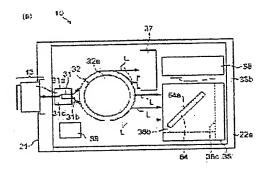


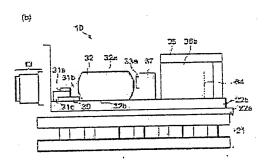




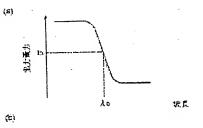


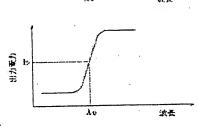


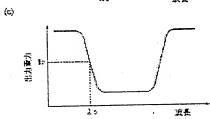




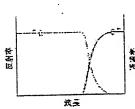
[图21]

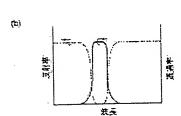


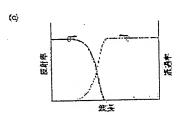




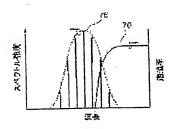






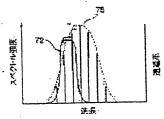


(a)

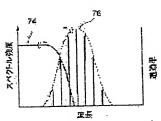


(図23)

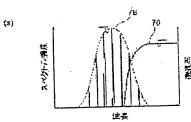
(b)

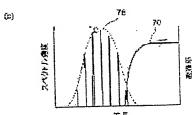


(c)



(@24)





# プロントページの競き

(72)発明者 谷田 和暴

神奈川県横浜市党区田谷町 1番地 住友電

氛工集株式会社横浜製作所内

(72)発明老 迪辺 容子

神奈川県横浜市奈区田谷町1番地 住友電

急工業株式会社描浜製作所內

(72)発明者 新開 次郎

神奈川県横浜市策区田谷町1番地 住友電

氨工業推式会社推浜製作所內

(72)発明者 高木 敏男

钟奈川県横浜市荣区田谷町 1 番地。住友皇

**氮工業株式会社横浜製作所内** 

(72) 発明者 佐々木 吾郎

神奈川県横浜市美区田谷町 3 番地 住友曼

**氯工業株式会社權漢製作所內** 

Fワーム(参考) 2HOS7 AAO1 BAO3 CAOO DA35 DA28

5F078 AA64 AB27 AB28 BA01 EAG3

FA02 FA15 FA25 FA30 GA13

GA14 GA19 GA22 GA23